【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成23年12月22日(2011.12.22)

【公表番号】特表2011-505193(P2011-505193A)
【公表日】平成23年2月24日(2011.2.24)
【年通号数】公開・登録公報2011-008
【出願番号】特願2010-536050(P2010-536050)
【国際特許分類】
Ａ６１Ｂ　18/12　　(2006.01)
Ａ６１Ｂ　 1/00　　(2006.01)
Ａ６１Ｍ　25/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６１Ｂ　17/39　　３１０
Ａ６１Ｂ　 1/00　　３００Ｊ
Ａ６１Ｂ　 1/00　　３２０Ｚ
Ａ６１Ｍ　25/00　　３１４
Ａ６１Ｍ　25/00　　３０６Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月31日(2011.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
灌流カテーテル装置と共に使用される灌流アブレーション電極アセンブリであって、
前記電極アセンブリの外面に配置された排出口を有する少なくとも１つの流体用通路と、
永久磁石と、
前記永久磁石を前記少なくとも１つの通路および外部から分離する、実質的に前記永久磁石よりも酸化しにくいシールドと、
外部電極表面を有する電極と、
を備え、
前記電極が前記電極アセンブリの遠位部分に配置されており、
前記永久磁石は、前記遠位部分に配置されており、
前記電極アセンブリの近位部分は、前記近位部分の外面に配置された排出口を有する少なくとも１つの流体用の近位通路を含む、灌流アブレーション電極アセンブリ。
【請求項２】
前記電極が前記シールドの少なくも一部を形成し、前記電極が実質的に前記永久磁石よりも酸化しにくい導電性材料を含む、請求項１に記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。
【請求項３】
前記近位部分が非導電性材料を含み、前記近位部分の前記外面と前記遠位部分にある前記電極の前記外部電極表面とが交差部分で交わり、前記少なくとも１つの近位通路が流体流を前記排出口を通って前記交差部分に隣接する領域に向かって導くように構成されている、請求項１又は２に記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。
【請求項４】

前記少なくとも１つの近位通路が前記近位部分の長手軸に対して鋭角に前記電極に向かって延在している、請求項１～３のいずれかに記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。

【請求項５】

前記近位部分が非導電性材料を含み、かつ前記電極の材料よりも低い熱伝導率を有する、請求項１～４のいずれかに記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。

【請求項６】

前記電極アセンブリが前記永久磁石に配置された少なくとも１つの温度センサをさらに備える、請求項１～５のいずれかに記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。

【請求項７】

アブレーション可能な遠位の電極である前記電極から近位に離間された少なくとも１つのマッピング電極をさらに備える、請求項１～６のいずれかに記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。

【請求項８】

前記電極に含まれる導電性材料が、白金、金、タンタル、イリジウム、ステンレス鋼、パラジウムおよびそれらの混合物からなる群から選択され、前記導電性材料が、実質的に前記永久磁石よりも酸化しにくい生体適合性材料で製造された基材にめっきされる、請求項１～７のいずれかに記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。

【請求項９】

前記シールドが、シリコーン、ポリイミド、白金、金、タンタル、イリジウム、ステンレス鋼、パラジウムおよびそれらの混合物からなる群から選択される１種または複数の材料を含む、請求項１～８のいずれかに記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。

【請求項１０】

前記永久磁石がＮｄＦｅＢを含む、請求項１～９のいずれかに記載の灌流アブレーション電極アセンブリ。

【請求項１１】

シャフトと、

前記シャフトの遠位端に連結された、請求項１～１０のいずれかに記載の灌流アブレーション電極アセンブリと、

を備える、カテーテル。

【請求項１２】

さらに、前記シャフトの前記遠位端近傍に配置され、かつ前記灌流アブレーション電極アセンブリ内の前記永久磁石から離間された第２の永久磁石を備える、請求項１１に記載のカテーテル。